

순번

258

기술명

공정가스 분석장치

- 특허번호 : 10-2015-0154988
- 보유기관 : 한국표준과학연구원
- 패밀리정보 : WOWO2017-078504A2
- 패키징특허 : 없음

기술개요

- 공정챔버에서 공정이 원하는 조건 하에서 제대로 진행되고 있는지 또는 환경오염가스가 배출되고 있는지 등의 여부를 모니터링 할 수 있는 기술
- 활용처 : 반도체 미세소자 제조 분야, 평판 디스플레이 분야

기존 한계점

- 발광부와 수광부 사이의 광경로가 매우 짧아 측정의 정밀도가 떨어진다는 단점
- 발광부와 수광부를 원하는 광분석방식에 따라 적절한 것으로 상황에 따라 교체하기가 사실상 불가능하다는 단점

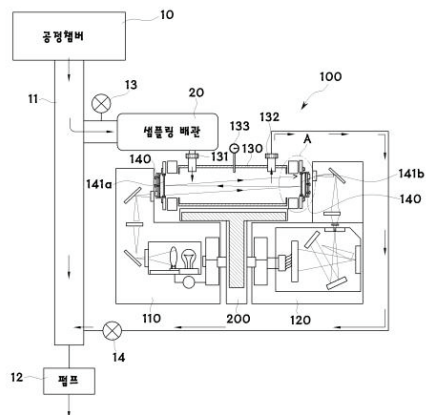
기술 차별점

- 공정챔버나 그 배기라인에 흐르는 공정가스를 샘플링 추출하여 수집할 수 있는 가스셀을 별도로 두고 여기에 다반사 광학부를 설치하여 광경로를 충분히 확보
- 광원부와 광검출부를 가스셀의 외부에 분해조립 가능하게 설치

세부내용

- 다반사 광학부에 의해 광경로가 충분히 확보될 수 있기 때문에 소량의 공정가스에 대해서도 정밀한 정량 및 정성 분석이 가능
- 광원부와 광검출부가 가스셀의 외부에 분해조립 가능하게 설치
- 따라서, 광분석 기법에 맞게 해당 광원부와 광검출부를 적절한 것으로 교체할 수 있음

대표 이미지



문의처

- 국가과학기술연구회 공동TLO마케팅사무국 엄예지 선임연구원
- T. 042-862-6986 E-mail. yjeum@wips.co.kr